
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN DE LA NOVENA EDICIÓN REVISTA A&D

Es un honor para mí, en mi rol de Directora y Jefa del Departamento Académico de Arte y Diseño, presentar la novena edición de la Revista A&D. Esta publicación arbitrada representa un hito significativo en nuestra labor académica, ya que se dedica a la difusión de investigaciones en las áreas del Arte y del Diseño de nuestra universidad. Los textos seleccionados para esta edición reflejan la diversidad de temas abordados en este campo y se destacan por ofrecer una perspectiva crítica y reflexiva. Como gestores del conocimiento académico, estamos comprometidos con su divulgación y con el fomento de un diálogo enriquecedor desde nuestras secciones hacia la investigación, creación e innovación en el Departamento.

La novena edición de la Revista A&D ha recibido valiosos textos de investigadores que abordan temas relevantes en el ámbito del arte y el diseño. Entre ellos, Diego Orihuela Ibáñez (PUCP) explora la importancia de la perspectiva en la tradición visual occidental en su relato visual “Obscuridad o lo humano como un subproducto de la imagen”. Claudia Catherine Valenzuela Suárez (PUCP) analiza la evolución del diseño gráfico y la complementariedad entre imagen y texto en su artículo “Los grabados de José Sabogal en libros y revistas: aportes al diseño gráfico peruano a inicios del siglo XX”. Alberto Patiño Núñez (PUCP) reflexiona sobre la construcción de identidades en la moda y cuestiona si lo estético está despolitizado o es una producción ideológica en su artículo “Moda, reificación y utopía: zapatillas de lujo y la estética worn out”. Luciano Pozo de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) se enfoca en la investigación de soportes alternativos y orgánicos en la práctica artística contemporánea y presenta un nuevo procedimiento gráfico desarrollado por él en su artículo “Florisgrafía: Modos de hacer en la producción gráfica. Investigación de soportes alternativos y orgánicos en la práctica artística contemporánea”. Además, Erika Lucía Vásquez Larraín (PUCP) reflexiona sobre cómo el icónico plano de Lima creado por Oliver Perrottet en 1977 actúa como dispositivo de poder que normaliza la marginalización y la injusticia en su artículo “Dibujando el rostro de Lima: el mapa de Perrottet y los imaginarios de modernidad del siglo XX”. Por último, la reseña de creación de Evelyn Mabel Núñez Alayo (PUCP) y Diego Contreras Mo-

rales (PUCP), titulada “Musas Terrenales: entre la apropiación y las nuevas representaciones. Una reseña en dos tiempos”, propone nuevas representaciones femeninas y desafía las ideas preconcebidas sobre la imagen de la mujer en el arte al recrear pinturas famosas de la historia del arte universal mediante la inserción de fotografías de dos mujeres peruanas en la exposición virtual “Musas Terrenales”.

La novena edición de la Revista A&D se destaca por su riguroso proceso de revisión por pares, lo cual refleja nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en la selección de los textos publicados. Hemos tomado medidas para garantizar que los artículos y reseñas presentados cumplan con los altos estándares académicos de la revista. En este sentido, hemos coordinado estrechamente con la Comisión de Comunicaciones de nuestro Departamento Académico para ampliar el alcance de la convocatoria y asegurar la inclusión de información detallada, como el mes de envío y aceptación de cada texto, así como la correcta citación APA de los documentos.

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los autores y colaboradores que han contribuido a la realización de esta edición. Su valioso aporte y dedicación han sido fundamentales para el éxito de la Revista A&D. También quiero reconocer el arduo trabajo de la Comisión de la Revista A&D, integrada por Rustha Pozzi Escot, Paula Cermeño y José Elías, así como el excelente trabajo realizado por Christian Arakaki en el diseño editorial. Su compromiso y profesionalismo han sido cruciales para lograr una publicación de calidad.

Esperamos que la lectura de esta edición de la Revista A&D sea inspiradora y estimulante para todos nuestros lectores. Nos enorgullece presentar estos trabajos de investigación y creación que reflejan la diversidad y la excelencia académica en el campo del arte y el diseño. Estamos seguros de que esta publicación contribuirá a enriquecer el diálogo académico y a promover la reflexión crítica en nuestra comunidad universitaria y más allá. Continuaremos trabajando arduamente para seguir brindando un espacio de difusión y divulgación de la investigación en el arte y el diseño en futuras ediciones de la Revista A&D.

Edith Meneses Luy

Jefa del Departamento Académico de Arte y Diseño
Directora de la revista A&D